単分散シリカ粒子の作製と形状制御

横浜国立大学 大学院工学研究院 金井俊光

Preparation of Monodisperse Silica Particles and Control of Their Morphology

Toshimitsu Kanai Faculty of Engineering, Yokohama National University

マイクロ流体技術を用いた単分散なシリカ粒子の作製方法を報告する。安価な水ガラス を原料として単分散な水ガラス液滴を作製し、その後、炭酸水素ナトリウムと反応させる ことにより、CV 値 3% 以下の単分散性の高いシリカ粒子が作製できる。さらにゲル化剤 を水ガラス溶液に溶解させておくことで雪だるま形状やコア・シェル形状が形成され、そ の後の紫外線照射により、単分散なシリカ – 高分子ゲルハイブリッド粒子が作製できるこ とを報告する。

A method for preparing monodisperse silica particles by microfluidic techniques is reported. Monodisperse water glass droplets are formed through the microfluidic device and are reacted with sodium hydrogen carbonate to prepare monodisperse silica particles with CV < 3%. In addition, we report that the droplets transform into the snowman or coreshell shape by addition of the gelation reagent and are photopolymerized by UV light irradiation to form monodisperse silica-polymer gel hybrid particles.

1. はじめに

シリカ粒子は、耐熱性、耐圧性、化学的安定性などの優れた性質により、多分野で利用さ れる基盤材料である。特に粒径の揃った単分散シリカ粒子は、液晶ディスプレイ用のスペー サー粒子、階層構造体やコロイド結晶の作製などにも利用され重要である。さらに雪だるま 型粒子やコア・シェル型粒子などの形状を制御した粒子は、ドラッグデリバリーシステム (DDS)や固体界面活性剤など、様々な分野で新しい応用・発展が期待されている^{1,2)}。これ まで単分散シリカ粒子や形状を制御した粒子は、stöber 法³⁾と呼ばれる Si のアルコキシ ドを原料に用いたゾル・ゲル反応をベースとした方法が一般的である。シード重合法と組 み合わせることにより、雪だるま形状やコア・シェル形状のシリカ - ポリマーハイブリッ ド粒子が作製されている。これらの方法で得られる粒子の単分散性は単分散性の指標であ る CV (Coefficient of Variation)値を用いて評価されており、おおよそ 5~10% 程度以下で ある。今後、様々な分野で高品質・高性能化が進んでいくことが予想され、さらに CV 値 の小さな極めて単分散性の高い粒子の作製方法の開発が重要である。またアルコキシドを 使用せずにより安価な原料によりシリカ以外のセラミックス材料にも適用でき得る方法の 開発が重要である。

本研究では、マイクロ流体技術を用いた単分散シリカ粒子の作製方法を開発することを 目的とする。具体的には、マイクロ流体デバイス内に安価な水ガラスを原料に用いて、単 分散性の高い水ガラス液滴を油相中に形成させる。その後、炭酸水素ナトリウムと反応さ せることにより、単分散なシリカ粒子の作製を試みる。さらに作製条件を調整することに より、雪だるま形状やコア・シェル形状のシリカ – 高分子ゲルハイブリッド粒子の作製を 試みる。

2. 実験方法

2.1 ガラスキャリラリー製マイクロ流体デバイスの作製

ガラスキャピラリーを組み合わせて、単分散 W/O エマルション形成用マイクロ流体デ バイス⁴⁾を作製した(Fig. 1 (a))。キャピラリープラーおよびマイクロホージを用いてキャ ピラリーの先端内径を 190 µm にテーパー加工した。これを角型キャピラリー内に挿入し、 連続相と分散相を流入させるポートを取り付け、W/O エマルション形成用デバイスとし た。



Fig. 1 Schematic illustration for preparation of monodisperse silica particles using the microfluidic device.

2.2 単分散シリカ粒子の作製

連続相として界面活性剤(RSN-0749)を添加したシリコーンオイル(50 cSt)を用い、分散 相として 0.01~7 M の水ガラス水溶液を用いて、それぞれマイクロ流体デバイス内に流 入させた。各流量をパラメータとし、CV 値 2%以下の単分散な水ガラス液滴が形成でき る粒径範囲を検討した。得られた W/O エマルションを 1M の炭酸水素ナトリウム水溶液 に滴下し、シリカ形成反応を行った(Fig. 1(b))。粒子を回収後、洗浄し 100℃で乾燥させた。

2.3 シリカー高分子ゲルハイブリッド粒子の作製

予め水ガラス水溶液にゲル化剤(アクリルアミド:モノマー、BIS:架橋剤、DAROCUR 1173:光重合開始剤)を溶解させておき、マイクロ流体デバイスを用いて単分散液滴を作 製した。その後、炭酸水素ナトリウムと充分に反応させ、液滴放出させた(Fig.1(c))。こ こで紫外線を照射し光重合を行うことで、シリカ粒子とアクリルアミドゲル粒子からなる 単分散ハイブリッド粒子の作製を行った(Fig.1(d))。水ガラスの濃度、反応時間、ゲル化 剤の濃度、紫外線照射条件などを検討し、形状制御条件を検討した。

3. 結果と考察

3.1 単分散シリカ粒子の作製

水ガラス濃度、分散相および連続相の流量を調整することにより、CV 値 2%以下の単 分散な水ガラス液滴をサイズ制御して作製することができた。例えば、Fig. 2 には水ガラ ス濃度 0.1M において、分散相である水ガラスの流量を 1.0mL/h に固定し、連続相の流 量を変更させた場合のデバイス内の液滴形成過程の写真を示す。Fig. 2 (a) に示すように連 続相の流量が 2.5mL/h では単分散な液滴は形成されなかったが、流量を増加させると、 CV 値 2% 以下の単分散な水ガラス液滴が連続的に形成された(Fig. 2 (b) - (d) および(f)-(h))。連続相流量が 2.6~7.0mL/h では液滴径は 183~116µm となった。連続相の流量 をさらに増加させると Fig. 2 (e) に示すように jetting の状態に遷移し、サイズ制御が難し くなった。得られた単分散水ガラス液滴を炭酸水素ナトリウムと反応させ、その後、洗浄、 乾燥させると、Fig. 2 (i) - (k) に示すように、粒径 33~17µm、CV 値 3% 以下の単分散なシ リカ粒子を作製することができた。



Fig. 2 Formation of W/O emulsions in the microfluidic device at the following flow rates of the inner phase: (a) 2.5, (b) 3.0, (c) 5.0, (d) 7.0, and (e) 7.5 mL/h. Optical micrographs of the droplets obtained at the flow rates of the inner phase of (f) 3.0, (g) 5.0, and (h) 7.0 mL/h. Optical micrographs of the silica particles obtained at the flow rates of the inner phase of (i) 3.0, (j) 5.0, and (k) 7.0 mL/h.

3.2 シリカー高分子ゲルハイブリッド粒子の作製

分散相として 3M の水ガラスと 2M のアクリルアミドからなる水溶液を用いた場合、 マイクロ流体デバイスにより同様の単分散液滴が形成されたが、炭酸水素ナトリウムと反 応させると、シリカ粒子から液滴が放出され、雪だるま形状となった(Fig. 3 (a))。この状 態で紫外線を照射し、アクリルアミドを光重合することでゲル粒子となり、雪だるま型の シリカ – 高分子ゲルハイブリッド粒子が作製できた(Fig. 3 (b))。またアクリルアミドの濃 度を 4M 以上とすると、放出する溶液がシリカ粒子を覆ったコア・シェル形状となった (Fig. 3 (c))。この状態で紫外線照射することにより、コア・シェル型のシリカ – 高分子ゲ ルハイブリッド粒子が作製できた(Fig. 3 (d))。雪だるま形状からコア・シェル形状への変 化は、界面張力の大きさの変化によると考えらえる。ある液体中で互いに混ざり合わない 2 種類の液体の相分離形態は、complete wetting、partial wetting、non-wetting の3つが考 えられ、これらは3種類の液体間の界面張力 で表される $S_{i}=\sigma_{jk}-(\sigma_{ij}+\sigma_{ik})$ によって整理で きる⁵⁾。すなわち、 $S_{1}<0, S_{2}<0, S_{3}>0$ のと き complete wetting、 $S_{1}<0, S_{2}<0, S_{3}<0$ の とき partial wetting、 $S_{1}<0, S_{2}>0, S_{3}<0$ の とき non-wetting となる。アクリルアミド濃 度の増加により水相の界面張力が低下し、 S_{3} の符号が正から負に変化したと考えられる。 その結果、雪だるま形状からコア・シェル形 状へ変化したと考えられる。

コア・シェル形状のシリカーポリアクリル アミド(PAAM)ゲル粒子をエタノール水溶液 中に添加すると、PAAM ゲル部分のみがエ タノール濃度に応じて体積変化した。Fig.4 に示すように、単分散コア・シェル粒子の PAAM シェル部分のみがエタノール濃度に 応じて収縮し、シェルの直径は約240µm か ら140µm となった。一方、シリカ粒子コア 部分はエタノール濃度に依らず、直径約 120µm のままであった。

4. 結論

マイクロ流体技術を用いて安価な水ガラス を原料として単分散な水ガラス液滴を作製 し、その後、炭酸水素ナトリウムと反応させ ることで、CV値3%以下の単分散なシリカ 粒子を作製することができた。さらに、ゲル 化剤を水ガラスに溶解させておくことで、雪 だるま形状やコア・シェル形状に変化でき、 その後の紫外線照射により、単分散なシリカ ー高分子ゲルハイブリッド粒子を作製するこ とができた。



Fig. 3 (a) Formation of the snowman shape at the AAM concentration of 2 M. (b) Snowman like silica-PAAM gel particles after UV light irradiation. (c) Formation of the core-shell shape at the AAM concentration of 5 M. (d) Core-shell like silica-PAAM gel particles after UV light irradiation.



Fig. 4 Photographs of the silica-PAAM gel coreshell particles at various ethanol concentrations ((a) 0, (b) 30, (c) 80, and (d) 100 wt.%) (d) Diameters of the particles as a function of the ethanol concentration.

5. 謝辞

本研究は、平成28年度日本板硝子材料工学助成会の研究助成を受けて行ったものであ る。感謝申し上げます。

6. 参考文献

- 1) H. C. Shum, A. R. Abate, D. Lee, A. R. Studart, B. G. Wang, C. H. Chen, J. Thiele, R. K. Shah, A. Krummel, and D. A. Weitz, Macromol. Rapid Commun., 31, 108 (2010).
- 2) J. W. Kim, R. J. Larsen, and D. A. Weitz, J. Am. Chem. Soc., 128, 14374 (2006).

- 3) W. Stöber, J. Colloid Interf. Sci., 26, 62 (1968).
- 4) T. Kanai, D. Lee, H. C. Shum, and D. A. Weitz, Small, 6, 807 (2010).
- 5) S. Torza and S. G. Mason, J. Colloid Interf. Sci., 33, 67 (1970).